

Кластер ПХО ТМ-300

Промышленно-ориентированный кластерный комплекс
плазмохимического осаждения для технологий уровня до 65 нм



Технические характеристики:

Характеристика	PECVD SiO ₂ (из SiH ₄)	PECVD Si ₃ N ₄ (из SiH ₄)	PECVD SiO ₂ (из TEOS)	SACVD SiO ₂ (из TEOS, O ₃)
Нагрев пластин, °C	400	480	400	550
Рабочее давление, Па	133 ÷ 1333	133 ÷ 1333	133 ÷ 1333	2×10 ⁴ ÷ 8×10 ⁴
Неравномерность осаждения, %	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Мощность генераторов, Вт	ВЧ: 2000 НЧ: 1000	ВЧ: 2000 НЧ: 1000	ВЧ: 2000 НЧ: 1000	Нет

- Система загрузки SMIF-контейнер / FOUP-контейнер
- Обработка пластин Ø 200, 300 мм
- Изменяемое межэлектродное расстояние
- Долговечная керамическая оснастка камеры
- Система подачи TEOS собственной разработки
- Удаленный источник плазмы для очистки камеры
- Генераторы двух различных частот для модулей PECVD
- Масса не более 6000 кг, включая транспортную систему
- Габариты (ШхГхВ) не более 4570x4580x2500 мм

